

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成17年12月2日(2005.12.2)

【公開番号】特開2001-92138(P2001-92138A)

【公開日】平成13年4月6日(2001.4.6)

【出願番号】特願平11-277377

【国際特許分類第7版】

G 03 F 7/039

C 08 K 5/23

C 08 L 77/06

G 03 F 7/022

G 03 F 7/037

H 01 L 21/027

【F I】

G 03 F 7/039

C 08 K 5/23

C 08 L 77/06

G 03 F 7/022 601

G 03 F 7/037 501

H 01 L 21/30 502 R

【手続補正書】

【提出日】平成17年10月19日(2005.10.19)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

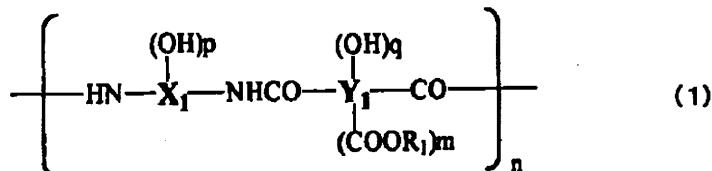
【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】(a)一般式(1)で示される繰返し単位を有するポリアミド100重量部と、

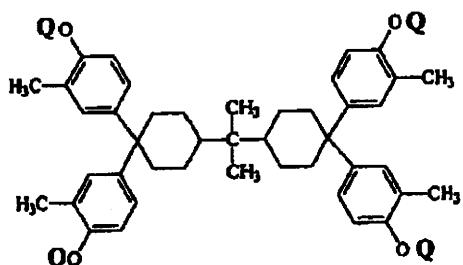
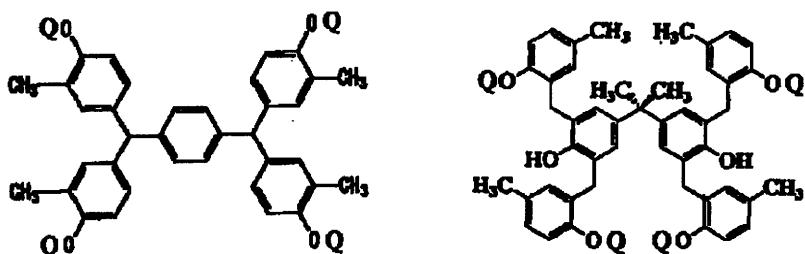
【化1】



(式中X1は少なくとも2個以上の炭素原子を有する2~4価の有機基、Y1は少なくとも2個以上の炭素原子を有する2~6価の有機基、p、qは0または1~4の整数、R1は水素、または炭素数1~20までの有機基であり、p、q共に0の場合フェノール性水酸基を少なくとも1つ有する、nは2~1000までの整数、mは0または1~2の整数、ただしm、p、qが同時に0であることはない。)

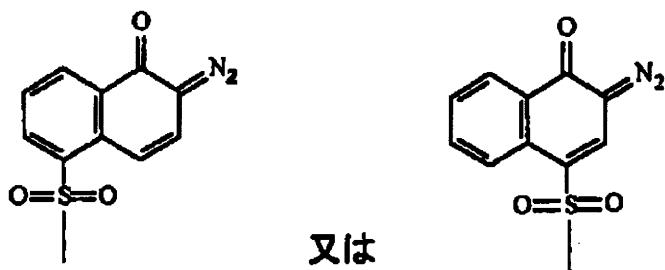
(b)下記一般式(2)で表される感光性ジアゾキノン化合物1~100重量部を必須成分とするポジ型感光性樹脂組成物。

【化2】



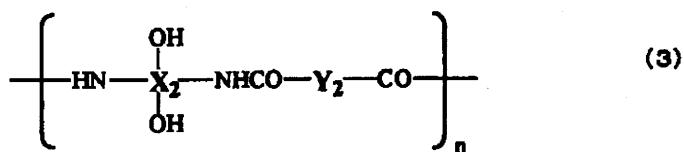
(2)

(式中、Qのうち少なくとも1個は下記で示される基であり残りは水素原子である。)
【化3】



【請求項2】ポリアミドが式(3)で示される繰返し単位を有することを特徴とする請求項1記載のポジ型感光性樹脂組成物。

【化4】



(式中X2は4価の芳香族基、Y2は2価の芳香族基、nは上記と同じ)

【請求項3】請求項1ないし2のいずれか1つに記載のポジ型感光性樹脂組成物を層またはフィルムの形で基板に施し、マスクを介して化学光線で露光するか又は、光線、電子線又はイオン線を直接照射した後、その露光部又は照射部を溶出又は除去し、次に得られたレリーフ構造物を焼結することを特徴とする高耐熱性レリーフ構造物の製造方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

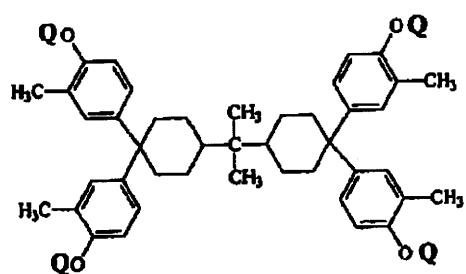
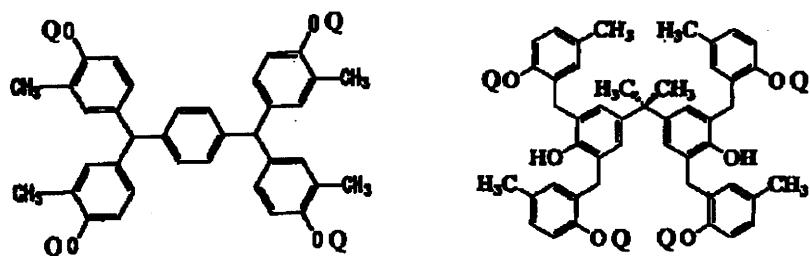
【補正対象項目名】0013

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0013】

【化7】



(2)

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 4】

(式中、Qのうち少なくとも1個は下記で示される基であり残りは水素原子である。)